PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-273899

(43) Date of publication of application: 22.10.1993

(51)Int.CI.

GO3H 7/004 GO3F

(21)Application number : **04-068116**

(71)Applicant: NISSAN MOTOR CO LTD

NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

26.03.1992

(72)Inventor: SUGAWARA SATOKO

NISHIDE RIICHI ISHII KAZUHIKO

SHIMURA KATSUNORI

(54) HOLOGRAM AND ITS FORMATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the hologram extremely improved in efficiency by using specific compds. for either of the host monomer and guest monomer forming a volumetric phase type hologram.

CONSTITUTION: The fluorine-contained compds. having the structure, expressed by formula I (where R is a hydrogen atom or methyl group; n is an integer from 1 to 10), formula II (where R is a hydrogen atom or methyl group, n is 1 or 2), formula III (where Rh is a hydrogen atom or methyl group, n is 1 to 10), etc., are used as the low-refractive index compd. of the volumetric phase type hologram, the diffraction gratings of which are formed of the distribution of ≥ 2 kinds of the compds. varying in refractive index. The fluorine- contained compds. to be

$$CH_{2} = CCO - \left(CH_{2}\right)_{1} \left(CH_{2}\right)_{2} \left(CH_{2}\right)_{2} - CCC = CH_{2}$$

$$\Pi$$

used have the refractive index of a value as low as ≤1.4 and therefore, have the characteristics excellent as the low-refractive index component forming the hologram and particularly when these compds. are used as the guest monomer, the compds. have the property to hardly flow out even after the compds, are injected into a recording medium and therefore, the volumetric phase type hologram having the extremely high efficiency is formed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DERWENT-ACC-NO:

1994-220197

DERWENT-WEEK:

199427

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

In a new vol. phase type hologram - one or a

mixt. of

fluorine contq. cpds. having one or a mixt. of

specified

structures is used as low refractive index cpd.

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON KAYAKU KK[NIPK] , NISSAN MOTOR CO LTD[NSMO]

PRIORITY-DATA: 1992JP-0068116 (March 26, 1992)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 05273899 A October 22, 1993 N/A

011 G03H 001/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 05273899A N/A 1992JP-0068116

March 26, 1992

INT-CL (IPC): G03F007/004, G03F007/027, G03H001/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05273899A

BASIC-ABSTRACT:

In a new, vol. phase type hologram forming diffracting lattices through

distribution of two or more cpds. of different refractive indexes, one or a

mixt. of fluorine-contg. cpds. having one or a mixt. of structures of formulae

(I), (II), (III) and (IV) is used as a low-refractive-index cpd. R =
H or CH3;

n=1 or for (II) and 1-10 for (I), (III) and (IV); X=-(CH2)6-, or gp. of

formula (i), (ii) or (iii).

In a new formation of a hologram, a recording support comprising a binder

8/30/05, EAST Version: 2.0.1.4

polymer(s), a photopolymerisable cpd(s). and a photopolymerisation initiator(s) is exposed to an interference pattern of a laser beam; the exposed

support is immersed in a developer contg. a photo- or het-polymerisable cpd(s).

and opt. a polymerisation initiator(s) for the cpd. to develop; and the

developed support was cured thermal layer with light. Either of the photopolymerisable cpd. in the support and the photo-/heat-polymerisable cpd.

in the developer is the fluorine-contg. cpd . having a structure of (I), (II),

USE/ADVANTAGE - The invention notably improves the efficiency of hologram formation.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

(III) or (IV).

TITLE-TERMS: NEW VOLUME PHASE TYPE HOLOGRAM ONE MIXTURE FLUORINE CONTAIN

COMPOUND ONE MIXTURE SPECIFIED STRUCTURE LOW REFRACT INDEX COMPOUND

DERWENT-CLASS: A89 G06 P84

CPI-CODES: A04-B09; A04-E10D; A10-B06; A12-L02C; G06-D; G06-E; G06-F03B;

G06-F03D; G06-G17; G06-G18;

ENHANCED-POLYMER-INDEXING:

Polymer Index [1.1]

017 ; G0373 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 D12 D10 D51 D53 D58 D63 F41 G0442 D11 D69 D87 D88 D89 D90 D91 D92 D93 F27 F26 F* 7A ; G0908

G0873 G0817 D01 D51 D54 D57 D63 D11 D10 D58 D69 F* 7A D90 D91 D92 D93 D94; G0908 G0873 G0817 D01 D51 D54 D57 D63 D11 D10 D58 D69 D94 D95 F78 F* 7A D14 D13 D19 D18 D31 D32; H0000; H0022 H0011; H0033 H0011; L9999 L2573 L2506; L9999 L2528 L2506; M9999 M2073

; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; P0088

Polymer Index [1.2]

017; ND04; ND01; B9999 B4444 B4240; Q9999 Q8355 Q8264; Q9999 Q8924*R Q8855; K9858 K9847 K9790; Q9999 Q8673*R Q8606; Q9999 Q8684 Q8673 Q8606; Q9999 Q8708 Q8606; N9999 N5889*R; K9847*R K9790; Q9999 Q8662 Q8606

Polymer Index [1.3]

017 ; C999 C077 C000 ; C999 C293

Polymer Index [1.4]

017 ; C999 C000*R ; C999 C293

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1994-099980 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1994-174057

PAT-NO: JP405273899A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05273899 A

TITLE: HOLOGRAM AND ITS FORMATION

PUBN-DATE: October 22, 1993

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
SUGAWARA, SATOKO
NISHIDE, RIICHI
ISHII, KAZUHIKO
SHIMURA, KATSUNORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
NISSAN MOTOR CO LTD N/A
NIPPON KAYAKU CO LTD N/A

APPL-NO: JP04068116

APPL-DATE: March 26, 1992

INT-CL (IPC): G03H001/02, G03F007/004, G03F007/027

US-CL-CURRENT: 430/2

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the hologram extremely improved in efficiency by using specific compds. for either of the host monomer and guest monomer forming a volumetric phase type hologram.

CONSTITUTION: The fluorine-contained compds. having the structure, expressed by formula I (where R is a hydrogen atom or methyl group; n is an integer from 1 to 10), formula II (where R is a hydrogen atom or methyl group, n is 1 or 2), formula III (where Rh is a hydrogen atom or methyl group, n is 1

to 10), etc., are used as the low-refractive index compd. of the volumetric

phase type hologram, the diffraction gratings of which are formed of the

distribution of ≥ 2 kinds of the compds. varying in refractive index. The

fluorine- contained compds. to be used have the refractive index of a value as

low as ≤1.4 and therefore, have the characteristics excellent as the

low-refractive index component forming the hologram and particularly when these

compds. are used as the guest monomer, the compds. have the property to

hardly flow out even after the compds. are injected into a recording medium

and therefore, the volumetric phase type hologram having the extremely high efficiency is formed.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-273899

(43)公開日 平成5年(1993)10月22日

(51)Int.CL⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 3 H 1/02

8106-2K

G03F 7/004

7/027

521

э

審査請求 未請求 請求項の数2(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平4-68116

(22)出題日

平成 4年(1992) 3月26日

(71)出願人 000003997

日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

(71)出顧人 000004086

日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

(72)発明者 菅原 聡子

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産

自動車株式会社内

(72) 発明者 西出 利一

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産

自動車株式会社内

(74)代理人 弁理士 杉村 晓秀 (外5名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ホログラムおよびその形成方法

(57)【要約】

【目的】 屈折率の異なる2種以上の化合物の分布によって、その回折格子が形成される体積位相型ホログラムを高い効率で形成する。

【構成】 バインダーボリマー、ホストモノマーである 光重合可能な化合物および光重合開始剤とからなる記録 担体をレーザー光の干渉パターンに露出した後、該記録 担体をゲストモノマーである光または熱重合可能な化合 物、或いはゲストモノマーとゲストモノマーの重合を開 始させる化合物を含有する現像液に浸漬して現像処理を 行ない、この際ホストモノマーとゲストモノマーのいず れか一方に特定のフッ素含有化合物を用い、次に熱また は光により記録担体を硬化させるホログラムの形成方 法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 屈折率の異なる2種類以上の化合物の分 布によって、その回折格子が形成される体積位相型ホロ グラムにおいて、低屈折率化合物として、次式

(化1)
$$\begin{pmatrix} CnF_{2n+1}CH_{2}CH & --- \\ CH_{2} & --- \end{pmatrix} OH$$

$$CH_{2} --- \rightarrow OCC = CH_{2}$$

(式中のRは水素原子またはメチル基、nは1~10の整 数を示す)、

* (式中のRは水素原子またはメチル基、nは1または2 を示す)、

【化3】

(式中のRは水素原子またはメチル基、nは1~10の整 数を示す) または 【化4】

(式中のRは水素原子またはメチル基、Xは

nは1~10の整数を示す)の構造を有するフッ素含有化 合物を使用したことを特徴とするホログラム。

【請求項2】 バインダーポリマー、光重合可能な化合 の干渉パターンに露出した後、該記録担体を光または熱 重合可能な化合物、或いは光または熱重合可能な化合物 とこの化合物の重合を開始させる化合物を含有する現像 液に浸漬して現像処理を行ない、ついで熱又は光により 記録担体を硬化させるホログラム形成方法であって、記 録担体中に含有される光重合可能な化合物と、現像液に 含有される光または熱重合可能な化合物のどちらか一方 が化1、化2、化3または化4の構造を持つフッ素含有 化合物であることを特徴とするホログラムの形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ホログラムおよびそ の形成方法、特に体積位相型ホログラムおよびその形成 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のホログラムおよびその形成方法と しては、例えば米国特許第3.993.485号明細書、同第4.1 73,474 号明細書、同第4,942,112 号明細書、特開平2 -3081号公報、特開平2-3082号公報に記載されている

★1. 28, No. 6, P586 ~591 (1989)、電子通信学会技術 研究報告Vol. 86, No. 134, P9~13に記載されている ものなどがあった。これらの従来技術はドライプロセス 物および光重合開始剤とからなる記録担体をレーザー光 30 によるものとウェットプロセスによるものとに大別され る. ウェットプロセスによるホログラム形成方法は効率 のよいホログラムが得られやすい、どの回折波長にも対 応できるなど、ドライプロセスに対する優位性は多い が、その反面プロセスが複雑で製造条件に左右されやす い欠点もあった。

【0003】上記の欠点を改良した従来技術としては、 バインダーボリマー、モノマー、光重合開始剤などで粗 成される記録担体に、レーザーによって干渉パターンを 露出した後、記録担体中に含まれるモノマーとは異なる 40 モノマーを含有する現像液に浸漬し、干渉パターンに従 って記録担体中のモノマーを抽出し、現像液中のモノマ ーで置換してホログラムを形成する方法があった。この ホログラム形成方法においては記録担体中に使用するモ ノマーをホストモノマー、現像液に含有されるモノマー をゲストモノマーと称するが、その一方にはより屈折率 の高い化合物を、もう一方にはより屈折率の低い化合物 を選択することが、高効率のホログラムを形成するため のポイントであった。特に低屈折率成分として、ゲスト モノマーに屈折率1.33~1.38のテトラフルオロプロピル もの、また、オプティカルエンジニアリング,June,Vo★50 アクリレート、ヘプタデカフルオロデシルアクリレー

ト、テトラフルオロプロピルメタクリレート、ヘプタデ カフルオロデシルメタクリレートを使用して、回折中心 波長が500nm 付近で80%前後までの効率を持つホログラ ムが得られた例があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来例で使用されているフッ素系モノマーは、ゲス トモノマーとして記録担体中に注入された場合、一旦置 かれた場所から非常に流出しやすい性質を有していたた め、干渉パターンが固定される前に、これらのゲストモ 10 ノマーがかなり流出し、低屈折率のものを使用してもそ の効果が完全には生かされず、回折中心波長500mm 前後 の場合90%以上の高効率ホログラムは得られない。ま た、回折中心波長がさらに長い場合には効率は低下し、 70%以下になるという問題点があった。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明は、このような 従来の問題点に着目してなされたもので、第1の発明は 屈折率の異なる2種以上の化合物の分布によって、その 回折格子が形成される体積位相型ホログラムにおいて、20 低屈折率化合物として次式

【化6】

$$\begin{pmatrix} \mathsf{CnF}_{2\mathsf{T}_1+1}\mathsf{CH}_2\mathsf{CH} - \\ \mathsf{CH}_2 - \end{pmatrix} - \begin{matrix} \mathsf{OC} - \mathsf{C} = \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \end{matrix} - \begin{matrix} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 - \mathsf{$$

(式中のRは水素原子またはメチル基、Xは

nは1~10の整数を示す)の構造を有するフッ素含有化 合物を使用したことを特徴とするホログラムに関するも のである。

【0006】また第2の発明はホログラムの形成方法に 関するものであって、該形成方法はバインダーポリマ ー、ホストモノマーである光重合可能な化合物および光 重合開始剤とからなる記録担体をレーザー光の干渉パタ ーンに露出した後、該記録担体を、ゲストモノマーであ る光または熱重合可能な化合物、或いはゲストモノマー とゲストモノマーの重合を開始させる化合物を含有する 現像液に浸漬して現像処理を行ない、ついで熱または光 により記録担体を硬化させるホログラムの形成方法であ * (式中のRは水素原子またはメチル基、nは1~10の整 数を示す)、

【化7】

$$CH_{2} = CCO - \left(CH_{2}\right)_{n} \left(-CF_{2}\right)_{1} \left(-CF_{2}\right)_{1} - CCC_{2} = CH_{2}$$

(式中のRは水素原子またはメチル基、nは1または2 を示す)、

【化8】

(式中のRは水素原子またはメチル基、nは1~10の整 数を示す)または 【化9】

★方、好ましくはゲストモノマーに、化6、化7、化8ま たは化9の構造を有するフッ素含有化合物であることを 特徴とするものである。

【0007】以下、この発明の詳細を説明する。まず、 記録担体を構成する成分について説明する。バインダー ポリマーとしては、ポリメタクリル酸エステル又はその 部分加水分解物、ポリ酢酸ビニル又はその加水分解物、 ポリスチレン、ポリビニルブチラール、ポリクロロプレ ン、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリ プロピレン、ポリーNービニルカルパゾール、又はその 誘導体、ポリーNービニルピロリドン又はその誘導体、 スチレンと無水マレイン酸の共重合体またはその半エス って、ホストモノマーとゲストモノマーのどちらかー ★50 テル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル

酸、メタクリル酸エステル、アクリルアミド、アクリル ニトリル等の共重合可能なモノマー群から選択されるモ ノマーを重合成分とする共重合体等が用いられる。

【0008】好ましくは、ポリーNービニルカルバゾー ル又はその誘導体であり、例えば、ポリーNーピニルカ ルバゾール、ビニルカルバゾールースチレン共重合体、 ビニルカルバゾールー塩化ビニル共重合体、ビニルカル バゾールーメチルメタクリレート共重合体、ビニルカル バゾールービニルアンスラセン共重合体、ビニルカルバ -アクリレート共重合体、ビニルカルバゾール-エチル アクリレート共重合体、ビニルカルバゾールーアクリロ ニトリル共重合体、ビニルカルバゾールーブチルアクリ レート共重合体、ビニルカルバゾールーニトロビニルカ ルバゾール共重合体、ニトロ化ポリーNービニルカルバ ゾール、ポリビニルアミノカルバゾール、ピニルカルバ ゾールーNーメチルアミノビニルカルバゾール共重合 体、ハロゲン置換ポリーNービニルカルバゾール、ビニ ルカルバゾールージブロムビニルカルバゾール共重合 ビニルカルバゾール、ポリプロペニルカルバゾール等が 挙げられる。

【0009】次に、光重合可能な化合物(ホストモノマ ー) について説明する。 ホストモノマーとしては、1分 子中に少なくともエチレン性不飽和二重結合を1個有す るモノマー、オリゴマー、プレポリマー及びそれらの混 合物が挙げられる。具体的には不飽和カルボン酸及びそ の塩、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物 とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化 合物とのアミド等である。

【0010】さらに具体的には、不飽和カルボン酸とし ては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロト ン酸、イソクロトン酸、マレイン酸、及びこれらのハロ ゲン置換不飽和カルボン酸、例えば塩素化不飽和カルボ ン酸、臭素化不飽和カルボン酸等が挙げられる。不飽和 カルボン酸の塩としては前述の酸のナトリウム塩及びカ リウム塩等がある。

【0011】また、脂肪族多価アルコール化合物と不飽 和カルボン酸とのエステルとしては、エチレングリコー ルジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレ 40 ート、1,3-ブタンジオールジアクリレート、テトラ メチレングリコールジアクリレート、プロピレングリコ ールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリ レート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ト リメチロールプロパントリ(アクリロイルオキシプロピ ル) エーテル、トリメチロールエタントリアクリレー ト、ヘキサンジオールジアクリレート、1、4-シクロ ヘキサンジオールジアクリレート、テトラエチレングリ コールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリ レート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペン 50 ト、ソルビトールテトラマレート等が挙げられる。

タエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリス リトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールトリ アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラアクリレ ート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソ ルビトールトリアクリレート、ソルビトールテトラアク リレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビト ールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイルオキシエ チル) イソアヌレート、ポリエステルアクリレートオリ ゴマー、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、テトラ **ゾールービニルピリジン共重合体、ビニルカルバゾール 10 ヒドロフルフリルアクリレート、また、エチレングリコ** ールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタ クリレート、1,3-ブタンジオールジメタクリレー ト、テトラメチレングリコールジメタクリレート、プロ ピレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリ コールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリ メタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレ ート、ヘキサンジオールジメタクリレート、1,4-シ クロヘキサンジオールジメタクリレート、テトラエチレ ングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトール 体、ポリヨードビニルカルバゾール、ポリベンジリデン 20 ジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリ レート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、 ジペンタエリスリトールジメタクリレート、ジペンタエ リスリトールトリメタクリレート、ジペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールへ キサメタクリレート、ソルビトールトリメタクリレー ト、ソルビトールテトラメタクリレート、ソルビトール ペンタメタクリレート、ソルビトールヘキサメタクリレ ート、ビスー〔p-(3-メタクリルオキシー2-ヒド ロキシプロポキシ) フェニル] ジメチルメタン、ビスー 〔p-(アクリルオキシエトキシフェニル〕ジメチルメ タン、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート等が挙げ sha.

6

【0012】 イタコン酸エステルとしては、エチレング リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1,3-ブタンジオールイタコネート、1, 4-ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレング リコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタ コネート、ソルビトールテトライタコネート等が挙げら れる。

【0013】 クロトン酸エステルとしては、エチレング リコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジ クロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、 ソルビトールテトラクロトネート等が挙げられる。

【0014】 イソクロトン酸エステルとしては、エチレ ングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトー ルジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロト ネート等が挙げられる。

【0015】マレイン酸エステルとしては、エチレング リコールジマレート、ペンタエリスリトールジマレー

【0016】ハロゲン化不飽和カルボン酸としては、 2.2.3.3-テトラフルオロプロピルアクリレー ト、1 H、1 H、2 H、2 H - ヘプタデカフルオロデシ ルアクリレート、2、2、3、3-テトラフルオロプロ ピルメタクリレート、1H, 1H, 2H, 2H-ヘプタ デカフルオロデシルメタクリレート等が挙げられる。

【0017】また、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミ ン化合物とのアミドとしては、メチレンピスアクリルア ミド、メチレンピスメタクリルアミド、1,6-ヘキサ メチレンビスアクリルアミド、1,6-ヘキサメチレン 10 えば臭素化物なども用いることができる。さらに日本接 メタクリルアミド、ジエチレントリアミントリスアクリ ルアミド、キシリレンピスアクリルアミド、キシリレン ビスメタクリルアミド、アクリルアミドブチルアルデヒ ドジメチルアセタール等が挙げられる。

【0018】その他の例としては、特公昭48-41708号 公報に記載された1分子に2個以上のイソシアネート基 を有するポリイソシアネート化合物、下記一般式 $CH_2 = C(R_1)COOCH_2CH(R_2)OH$

(式中のR1, R2 は水素原子或いはメチル基を表わ す)で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加*20

*させた1分子中に2個以上の重合性ビニル基を含有する ビニルウレタン化合物等が挙げられる。

8

【0019】また、特開昭51-37193 号公報に記載され たウレタンアクリレート類、特開昭52-30490 号公報、 特公昭49-43191 号公報、特開昭48-64183 号公報にそ れぞれ記載されているようなポリエステルアクリレート 類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル等の多官能性アク リレートやメタクリレートを挙げることができる。

【0020】エポキシアクリレートのハロゲン化物、例 着協会誌Vol. 20, No. 7, 300 ~308 頁に光硬化性モノ マー及びオリゴマーとして開示されているものも使用す ることができる。フェノール類と不飽和カルボン酸との エステル、例えばトリブロモフェノールアクリレート、 トリプロモフェノールメタクリレート、テトラプロモフ ェノールアクリレート、テトラブロモビスフェノールA ジ (メタ) アクリレート等も使用することができる。 【0021】さらに、次式

【化11】

【化12】

で表わされるトリアクリレート類、例えば、東亜合成化 学工業 (株) 製、商品名、アクロニクスIB15又はIB25、 また、2、2′ービス(4ーアクリロキシ・ジエトキシ フェニル) プロパン (新中村化学(株)製、商品名、NX

※クリレート(新中村化学(株)製、商品名、NXエステル A-TMMT) 等も使用することができる。 【0022】下記構造式

【化13】

★【化15】

【化16】

☆で表わされる4種の化合物例えば、SNPE社製、商品 名、ACTICRYL CL 993,959,960,1039も有効であ **☆50 გ.**

【0023】さらに化6、化7、化8、化9の構造を有 するフッ素含有化合物を用いることもできる。

【0024】次に、光重合開始剤としては、ベンゾイン アルキルエーテル類、ケタール類、オキシムエステル 類、ベンゾフェノン、チオキサントン誘導体、キノン、 チオアクリドンなどの芳香族ケトン類、1,3-ジ(t -ブチルジオキシカルボニルベンゼン、ヨードニウム塩 類、ジアニン、ローダミン、サフラニン、マラカイトグ リーン、メチレンブルーなどのアルキルまたはアルキル ほう酸塩、鉄-アレーン錯体、ビスイミダゾール類、N 10 チルなどの置換又は非置換のC1 ~C6 のアルキル基、 -アリールグリシンなどを使用することができる。

【0025】また、光重合開始剤の感度を増すために、 可視光増感色素を加えた系とする事が望ましい。可視光 増感色素としては、例えばミヒラーズケトンなどの芳香 族アミン、キサンテン系色素、チオピリリウム塩、メロ シニン・キノリン系色素、クマリン・ケトクマリン系色 素、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、ジアニン、 フタロシアニン、ポルフィン、ローダミン、サフラニ ン、マラカイトグリーン、メチレングリーン等が用いら ns.

【0026】特に好ましいのは、下記一般式 【化17】

(式中のR5 , R6 , R7 はそれぞれ水素原子、又は塩 素原子、又は低級ジアルキルアミノ基、又は低級ジアル ロ原子の総数が5~9個の複素環基、又は一COY基を 表わす。ここにYは炭素数1~4の置換又は非置換のア ルキル基、低級アルコキシ基、置換又は非置換のフェニ ル基、置換又は非置換のステリル基、又は置換又は非置 換の3¹ークマリノ基、Zは水素原子又はシアノ基を示 す。) で表わされるクマリン化合物と有機過酸化物から なる重合開始剤の系である。上式においてR5 , R6 , R1として好ましくは水素原子、塩素原子、メトキシ、 エトキシ、ブトキシ等の低級アルコキシ基、ジメチルア ミノ、ジエチルアミノ、N-メチル-N-プロピルアミ 40 ノ等の低級ジアルキルアミノ基、N-モルホリノ、N-ヒペリジノ等の脂環式アミノ基、ジプロペニルアミノ、 ジ (α-メチルプロペニル) アミノ基等の低級ジアルケ ニルアミノ基等が挙げられる。

【0027】また、Xにおける複素環基としては2-イ ミダゾール、2-N-メチルイミダゾール、2-ベンズ イミダゾール、2-(4-フェニル)-イミダゾール、 2-オキサゾール、2-ベンズオキサゾール、2-(4 -フェニル) オキサゾール、2ーチアゾール、2ーベン ズチアゾール、2-(4-フェニル)チアゾール、2- 50 部である。 特に好ましくは、 バインダーポリマー100 重

(5-フェニル) チアジアゾール、2-(5-トリル) チアジアゾール、2-(5-ピフェニル)チアジアゾー ル、2-(5-フェニル)オキサジアゾール、2-(5

10

-p-メトキシフェニル) オキサジアゾール、2-(5 -p-クロルフェニル) オキサジアゾール等の残基が挙 げられる。

【0028】さらに、-COY基におけるYとしてはメ チル、エチル、プロピル、ヘキシル、β-シアノエチ ル、エトキシカルボニルメチル、ブトキシカルボニルメ フェニル、pーシアノフェニル、pーメチルフェニル、 p-メトキシフェニル、m-ヒドロキシカルボニルフェ ニル等の置換又は非置換のフェニル基、ステリル、p-メトキシステリル、pーシアノステリル、mークロルス テリル等のステリル基、及び下記一般式

【化18】

20

(式中R5 , R6 , R7 , Zは前記化17におけるものと 同じものを示す)で表わされる3-クマリノ基等が挙げ られる。

【0029】クマリン化合物の具体例としては3-アセ チルーフージメチルアミノクマリン、3ーベンゾイルー **7ージメチルーアミノクマリン、3ーベンゾイルー5**, **7ージメトキシクマリン、メチル、7ージエチルアミノ** -3-クマリノイルアセテート、3-シンナモイルー7 ケニルアミノ基又は脂環式アミノ基、Xは炭素及びヘテ 30 ージエチルアミノクマリン、3,3'ーカルボニルビス (7-ジエチルアミノ)クマリン、3,3'-カルポニ ルビス (5, 7ージメトキシアミノ) クマリン、7ージ エチルアミノー5, 7′ージメトキシー3, 3′ービス クマリン、3-(2′-ベンズイミダゾイル)-7-ジ エチルアミノクマリン、3-(2'-ベンズオキサゾイ ル) -7-ジエチルアミノクマリン、3-(5'-フェ ニルチアゾイルー2′)ー7ージエチルアミノクマリ ン、3-(2'-ベンズチアゾイル)-7-ジエチルア ミノクマリン、3、3′ーカルボニルビス(4ーシアノ -7-ジエチルアミノ)クマリン等が挙げられる。

> 【0030】有機過酸化物とクマリン化合物との割合 は、クマリン化合物1重量部に対して有機過酸化物1重 量部~100 重量部、好ましくはクマリン化合物1重量部 に対して、有機過酸化物1重量部~50重量部の割合で使 用する。

> 【0031】記録担体を構成する各成分の組成比は、好 ましくはバインダーポリマー100 重量部に対して、ホス トモノマーを10重量部~300 重量部、光重合開始剤又は 可視光増感色素を含む光重合開始剤の系を1~100 重量

量部に対して、ホストモノマーを30重量部〜150 重量 部、光重合開始剤と可視光増感色素をあわせて1重量部 から30重量部の割合で使用する。

【0032】また、上記組成物の他に記録担体には酸素 捕獲剤、熱重合禁止剤、可塑剤、紫外線吸収剤などの成 分を添加することもできる。

【0033】本発明においては、上記組成物を例えばベンゼン、クロルベンゼン、テトラヒドロフラン、1,4 ージオキサン、1,2ージクロルエタン、ジクロルメタン、クロロホルム等の溶媒に溶解して感光液とし、ガラ10ス又は透明樹脂製の板又はフィルム上に塗布する。その後乾燥を行ない、溶媒を蒸発させ記録担体を得る。

【0034】 感光液の塗布方法としては、スピンナーコーティング、ブレードコーティング、ロールコーティング等があり、乾燥後、膜厚が1μ ~ 100μ になるように塗布を行なう。膜厚の調整は溶媒中の組成物の濃度、塗布時の膜厚などで行なわれるが、場合によっては数回の塗布及び乾燥を繰り返し、厚膜を得ることもできる。尚、バインダーボリマー自体の支持性を利用してそれ自身をフィルム化してもよい。さらに、記録担体の空20気に接触している面には、ボリビニルアルコール水溶液などでコーティングを行ない、空気を遮断するようにすると、酸素による重合阻害が生じず、感度を上げることができる。

【0035】このようにして得られる記録担体は、例えば457.9nm、488nm、514.5nm、528.7nm 等に輝線を有するレーザー光に感度を有しており、例えば488nm の波長を有するアルゴンイオンレーザーに対して1~500mJ/cm²のエネルギーで実用域での回折効率を与えるものである。

【0036】次に、本発明のホログラム形成方法を説明する。本発明のホログラム形成方法は、輻射線への記録担体の露出工程、ゲストモノマーを含有する現像液を使用しての現像工程、そしてゲストモノマーでホストモノマーを部分的に置換された記録担体の光又は熱硬化過程による。記録担体の輻射線への露出工程において、使用し得る輻射線としては、レーザー光線、水銀ランプ等を光源とする輻射線が好ましい。

【0037】ホログラム形成に際しては、例えば、ある特定の波長に対するミラーを形成する場合には、図1の ルエチルケトンようなリップマン型ホログラム形成装置、図2のようなデニシューク型ホログラム形成装置が用いられる。また、アルゴンレーザーから発信されるような500mm 前後の波長の光を用いても、図3又は図4のようなガラスブロックを使用した光学系を用いれば、近赤外線などの比較的長い波長の光線を反射するようなミラーを形成することができる。なお図1〜図4において1はアルゴンレーザー、2はスペイシャルフィルター、3はレンズ、4は記録担体、5はアルミニウム平面ミラー、6は屈折率マッチング液、7はレーザー光線、8はミラー、9はハ50物を使用する。

ーフミラー、10はガラスブロックを示す。

【0038】次に、記録担体に現像処理を行なう。露光 前に記録担体の露出面にポリビニルアルコールなどによ るコーティング処理を行なった場合には、コーティング 膜を剥す。現像処理はホログラム潜像が形成された記録 担体を、ゲストモノマーを含有する現像液またはゲスト モノマーとゲストモノマーの重合を開始させる化合物を 含有する現像液に浸漬することにより行なわれる。現像 液にゲストモノマーの重合を開始させるための化合物を 加えると、この後に行なうホログラムの固定を迅速に行 なうことができる。この現像工程は、記録担体に、その 形成されたホログラムパターンに応じて、未重合のホス トモノマーまたはホストモノマーの低重合度成分を現像 液中に溶出させるとともに、記録担体中にゲストモノマ 一及び重合開始剤を含有する現像液を浸透させて、未重 合のホストモノマーまたはホストモノマーの低重合度成 分をゲストモノマーで置換する、又はホストモノマーに ゲストモノマーを付加させるものである。

12

【0039】現像液における溶媒は、露光によりホログ ラム潜像を形成された記録担体中の、バインダーポリマ 一及びホストモノマーの重合体を、あまり溶解しない、 又は殆ど溶解しないもので、未重合のホストモノマーや ホストモノマーの低重合度の成分を速やかに溶出させる ものでなければならない。また、記録担体に膨潤又は収 縮を生じさせる機能を含むものでもよい。具体的には、 例えばベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、nープロピルペンゼン、クメン、フェノール、クレ ゾール、クロルベンゼン、ジクロルベンゼン、ニトロベ ンゼン、ベンジルアルコール、ベンジルクロライド、ベ 30 ンジルブロマイド、αーメチルナフタリン、αークロル ナフタリン等のベンゼン、ナフタリンの誘導体、また、 nーペンタン、nーヘキサン、nーヘプタン、nーオク タン、イソオクタン、シクロヘキサン等のアルカン、シ クロアルカン類、メチルアルコール、エチルアルコー ル、nープロピルアルコール、イソプロピルアルコー ル、nーブチルアルコール、tーブチルアルコール、n ーアミルアルコール、イソアミルアルコール等のアルコ ール類、ジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、ジ イソプロピルエーテル等のエーテル類、アセトン、メチ ルエチルケトン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸メチ ル、蟻酸エチル、プロピオン酸メチル等のエステル類等 が使用され、又これらの混合溶媒を使用してもよい。 【0040】次に、現像液における光または熱重合可能 な化合物 (ゲストモノマー) について説明する。 ゲスト モノマーとしてはホストモノマーとして記載したものを 使用することができる。ただしホストモノマーとゲスト モノマーのどちらか一方には、化6、化7、化8または 化9の構造を有するフッ素化合物を必ず使用しなければ ならない。好ましくはゲストモノマーに上記フッ素化合

【0041】現像液に重合開始剤を加える場合には、以下に記述するようなものを使用することができる。ゲストモノマーを光重合により硬化させる場合には、例えばベンゾインアルキルエーテル類、ケタール類、オキシムエステル類、ベンゾフェノン、チオキサントン誘導体、キノン、チオアクリドンなどの芳香族ケトン類、1,3ージ(tーブチルジオキシカルボニルベンゼン、ヨードニウム塩類、ジアニン、ローダミン、サフラニン、マラカイトグリーン、メチレンブルーなどのアルキルまたはアルキルほう酸塩、鉄ーアレーン錯体、ビスイミダゾール類、Nーアリールグリシンなどを使用することができる。

【0042】メチルケトンパーオキサイド、シクロヘキ サノンパーオキサイド、アセチルアセトンパーオキサイ ド、セーブチルパーオキサイド、クメンハイドロパーオ キサイド、ジイソプロピルベンゼンーパーオキサイド、 t-ブチルクミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサ イド、 α , α' ーピス (tーブチルクミルパーオキシイ ソプロピル) ベンゼン、 t - ブチルパーオキシイソプロ ピルカーボネート、ベンゾイルパーオキサイド、ジ(t 20) ーブチルパーオキシ)イソフタレート、ジ(t-ブチル パーオキシ) テレフタレート、ジ(tーブチルパーオキ シ) フタレート、tーブチルパーオキシベンゾエート、 3, 3', 4, 4' ーテトラー (tーブチルパーオキシ カルボニル) ベンゾフェノン、2、5ージメチルー2、 5- (ジベンゾイルパーオキシ) ヘキサン等の有機過酸 化物は、光重合及び熱重合のどちらの重合開始剤として も使用することができる。また熱重合開始剤としては、 アゾビスイソブチロニトリル (AIBN) などのアゾ系 のラジカル重合開始剤を用いることができる。

【0043】現像工程としては、上記の工程以外に、まず溶媒のみを使用して記録担体の未重合のホストモノマーやホストモノマーの低重合成分を除去してからゲストモノマーに浸漬してもよい。

【0044】現像液におけるゲストモノマーの濃度は適*

* 宜設定されるが、10重量%~70重量%が好ましい。10重量%未満では置換を行なうためのゲストモノマーが不足し、70重量%を越えると溶媒濃度が小さくなりすぎるためホストモノマーを十分に抽出することができない。また、重合開始剤を加える場合には、ゲストモノマー100重量部に対して、重合開始剤1重量部~100重量部が好ましい。

14

エウム塩類、ジアニン、ローダミン、サフラニン、マラカイトグリーン、メチレンブルーなどのアルキルまたはアルキルほう酸塩、鉄ーアレーン錯体、ビスイミダゾー 10 縮の程度を調節し、干渉稿の間隔を制御することができる。好ましくは、現像処理を終えた後、記録担体の露出表面をガラスや樹脂製のプレートまたはフィルムでカバーし、ホストモノマーを置換したゲストモノマーが流出サノンパーオキサイド、アセチルアセトンパーオキサイ することを防止する。

【0046】続けて記録担体は硬化工程に付される。硬化工程では、現像処理により記録担体中に残留した現像液溶媒を適宜取り除き、記録担体を紫外線等の光照射するかあるいは加熱することによりゲストモノマーを硬化させ、ホログラムを固定する。前工程において、記録担めの露出表面をプレートやフィルムなどでカバーした場合には、ゲストモノマーの硬化終了後にこれを取り外すこともできる。

[0047]

【作用】次に作用を説明する。本発明において使用するフッ素含有化合物は、屈折率が1.4 以下と低い値を持つため、ホログラムを形成する低屈折率成分として優れた特性を持ち、特にゲストモノマーとして使用した場合、記録担体中に注入された後も流出しにくい性質を持つことから、極めて効率が高い体積位相型ホログラムを形成30 することができる。

[0048]

【実施例】次に本発明を実施例により説明する。

実施例1

下記組成

【表1】

・ボリーNービニルカルバゾール (亜南香料 (株) 製、商品名、ツビコール-210 、平均分子量80万) ---- 1.0g

・トリブロモフェノールメタクリレート (第一工業製薬(株)製、商品名、ニューフロンティアBR-31) ---- 0.5g

·3,3',4,4'-テトラ(t-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェ ノン ---- 0.08 g

・3, 3'-カルボニルビス (7-ジエチルアミノクマリン) --- 0.003g

を有する組成物を 1 , 4 - ジオキサン15 g に溶解し、0. 25 μm のフィルターで戸過し、感光液を得た。この感光液を1.5mm 厚のガラス板上に約0.1mm (4ミル)の厚さに製膜し、74℃で30分間乾燥した後、厚さ10 μm の記録担体を得た。記録担体の表面にはポリビニルアルコール(クラレ(株)製、重合度500、酸化度88%)の10%水溶液を、スピンコーターで2000 rpm で20秒間回転塗布し、風乾させた。

※【0049】ついで、図2に示す光学系を用いて、アルゴンレーザーによる488nmの波長の光で、レーザー光の記録担体への入射角を両面とも40度、露光エネルギーを30mJ/cm²になるように、ホログラムを露光した。露光後、記録担体表面のポリビニルアルコール膜を除去した。その後、現像処理を行なった。現像液は、次式【化19】

%50

$$\begin{pmatrix}
CF_{3}CF_{2}CF_{2}CF_{2}CF_{2}CH_{2}CH_{-} & -OH \\
CH_{2} & -OCCH = CH_{2}
\end{pmatrix}$$

で表わされる化合物の40重量%アセトン溶液を用いた。 記録担体を上記組成物の現像液に20秒間撹拌しながら浸 漬し、引き上げた後手早く記録担体の露出面をガラス板 を用いて封止した。現像処理を終えた記録担体を室内の 蛍光灯の下で固定化のための露光を行なった。3時間後 10 にゲストモノマーの硬化がほぼ終了したので、記録担体 の露出面を覆っていたガラス板を取り外し、体積位相型 反射ホログラムを得た。ホログラムの回折効率は98%、 回折中心波長は480nm であった。

【0050】実施例2

実施例1と同様に記録担体を作製し、図3に示す方法で 488mm のアルゴンイオンレーザーで露光を行なった。露 光条件は、レーザー光のガラスブロックへの入射角を20 度、露光エネルギー量を25mW/cm² とした。露光後記録 担体表面のコーティング膜を剥し、現像処理を行なっ た。現像液にはゲストモノマーとして次式

で表わされる化合物を35重量%含むアセトン溶液を用 い、液を撹拌しながら記録担体を20秒間現像液に浸漬し た。現像処理後実施例1と同様にゲストモノマーの硬化*

16

【0051】実施例3

実施例1においてホストモノマーとして次式

【化21】

で表わされる化合物を用い、ゲストモノマーとしてトリ ブロモフェノールアクリレート (第一工業製薬(株) 製、商品名、ニューフロンティアBR31)を用いて、他の 20 条件を同様にしてホログラムを形成した。ホログラムの 回折効率は91%、回折中心波長は560nm であった。

【0052】実施例4

実施例1において、ホストモノマーとしてトリブロモフ ェノールメタクリレート(第一工業製薬(株)製、商品 名、ニューフロンティアBR-31M) を用い、ゲストモノマ ーとして次式

【化22】

$$\begin{bmatrix} F_3C(CF_2)_5CH_2CH - \\ CH_2 - \end{bmatrix} - \begin{matrix} OCCH = CH_2 \\ CH_2 - \end{bmatrix} - \begin{matrix} CH_2 = CHCO - \\ CH_2 - CH_2 \\ CH_2 - CH_2 \end{matrix} - \begin{matrix} CH_2 - CH_2 \\ CH_2 - CH_2 \\ CH_2 - CH_2 \end{matrix}$$

%50

で表わされる化合物を使用して、図1に示す露光方法 で、波長514.5mm のアルゴンレーザー光で露光を行なっ た。記録担体へのレーザー光の入射角は30度、露光エネ ルギー量は40mk/cm² とした。その後実施例1と同様に 現像、硬化処理を行ないホログラムを得た。ホログラム の回折効率は96%、回折中心波長は510nm であった。

【0053】実施例5

実施例1において、ホストモノマーとしてテトラブロモ ビスフェノールAジメタクリレート(第一工業製薬

(株) 製、商品名、ニューフロンティアBR-42M)、ゲス トモノマーとして化20の化合物を使用し、図1に示す露 光方法で、波長514.5mm のアルゴンレーザー光で露光を 行なった。記録担体へのレーザー光の入射角は30度、露 光エネルギー量は40ml/cm² とした。その後実施例1と 同様に現像、硬化処理を行ないホログラムを得た。ホロ グラムの回折効率は96%、回折中心波長は520mm であっ た.

※【0054】実施例6

実施例1において、ホストモノマーとしてテトラブロモ ビスフェノールAジアクリレート (第一工業製薬(株) 製、商品名、ニューフロンティアBR-42)を、ゲストモ ノマーとして化19の化合物を使用し、実施例1と同様に ホログラムを形成した。ホログラムの回折効率は94%、

40 回折中心波長は480mm であった。

[0055]

【発明の効果】以上説明してきたように、この発明によ れば、体積位相型ホログラムを形成するホストモノマー とゲストモノマーのどちらか一方に、好ましくはゲスト モノマーに化6、化7、化8または化9の構造を有する フッ案含有化合物を使用することにより、効率が著しく 改善されたホログラムが得られるという効果が得られ た。

【図面の簡単な説明】

【図1】ホログラフィック回折格子露光法の説明図であ

17

る.

【図2】他の方法によるホログラフィック回折格子露光 法の説明図である。

【図3】ガラスブロックを用いたホログラム形成装置に よるホログラフィック回折格子露光法の説明図である。

【図4】ガラスブロックを用いた他のホログラム形成装 置によるホログラフィック回折格子露光法の説明図であ る.

【符号の説明】

1 アルゴンレーザー

2 スペイシャルフィルター

3 レンズ

4 記録担体

5 アルミニウム平面ミラー

6 屈折率マッチング液

7 レーザー光線

8 ミラー

9 ハーフミラー

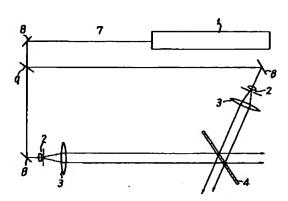
10 ガラスブロック

10

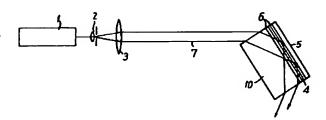
【図1】

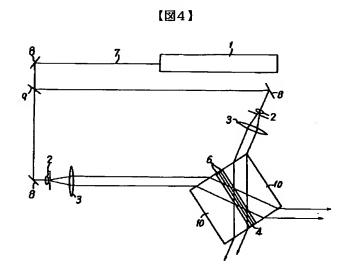
【図2】

18



【図3】





フロントページの続き

(72) 発明者 石井 一彦 埼玉県与野市上落合1039 (72)発明者 志村 克則 埼玉県与野市上落合1090

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Industrial Application] This invention relates to a hologram and its formation approach especially a volume phase mold hologram, and its formation approach.
[0002]

[Description of the Prior Art] As a conventional hologram and its conventional formation approach for example, a U.S. Pat. No. 3,993,485 specification -- said -- the 4,173,474th a number specification -- said -- the 4,942,112nd what is indicated by a number specification, JP,2-3081,A, and JP,2-3082,A -- Moreover, there were optical engineering, June, Vol.28, No.6, P586 -591 (1989), Institute of Electronics and Communication Engineers technical research report Vol.86, No.134, a thing indicated by P9-13. These conventional techniques are divided roughly into what is depended on a dry process, and the thing to depend on wet process. There was many predominance over a dry process -- that an efficient hologram is easy to be obtained and the hologram formation approach by wet process can respond to every diffracted-wave length -- but on the other hand the fault which a process is complicated and tends to be influenced by manufacture conditions also had them.

[0003] After exposing an interference pattern to the record carrier composed by the binder polymer, the monomer, a photopolymerization initiator, etc. with laser as a conventional technique which improved the above-mentioned fault, it was immersed in the developer containing a different monomer from the monomer contained in a record carrier, the monomer in a record carrier was extracted according to the interference pattern, and there was the approach of permuting by the monomer in a developer and forming a hologram. Although the monomer which contains the monomer used into a record carrier in this hologram formation approach in a host monomer and a developer was called the guest monomer, it was the point for forming an efficient hologram to choose a compound with a more high refractive index as one of these, and to choose a compound with a more low refractive index as another side. The tetrafluoropropylacrylate of refractive indexes 1.33-1.38, heptadeca fluoro decyl acrylate, tetrafluoro propyl methacrylate, and heptadeca fluoro DESHIRU methacrylate are especially used for a guest monomer as a low refractive-index component, and diffraction core wavelength is 500nm. There was an example from which the hologram which has the effectiveness of 80% order near was obtained.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, the fluorine system monomer currently used in such a conventional example Since it had the property which is very easy to flow out of the once placed location when poured in into a record carrier as a guest monomer, Before an interference pattern is fixed, even if these guest monomers flow out considerably and use the thing of a low refractive index, the effectiveness is not employed efficiently completely, but it is the diffraction core wavelength of 500nm. In before and after, 90% or more of efficient hologram is not obtained. Moreover, when diffraction core wavelength was still longer, effectiveness fell and had the trouble of becoming 70% or less.

[0005]

to such a conventional trouble to the volume phase mold hologram in which that diffraction grating is formed according to distribution of two or more sorts of compounds with which refractive indexes
differ, and it is a degree type [** 6] as a low refractive-index compound.
■ ID=000007
They are (in R in a formula, a hydrogen atom or a methyl group, and n show the integer of 1-10), and [Formula 7].
x ID=000008
They are (in R in a formula, a hydrogen atom or a methyl group, and n show 1 or 2), and [Formula 8].
x ID=000009
(As for a hydrogen atom or a methyl group, and n, R in a formula shows the integer of 1-10) Or [Formula 9]
x ID=000010
(For R in a formula, a hydrogen atom or a methyl group, and X are [Formula 10].)
x ID=000011
n is related with the hologram characterized by using the fluorine content compound which has the structure which shows the integer of 1-10.

[0006] The 2nd invention is a thing about the formation approach of a hologram. This formation approach Moreover, a binder polymer, After exposing to the interference pattern of laser light the record carrier which consists of the compound which can be photopolymerized and photopolymerization initiator which are a host monomer, The light which is a guest monomer about this record carrier, or the compound in which thermal polymerization is possible, Or it is immersed in the developer containing the compound which makes the polymerization of a guest monomer and a guest monomer start, and a development is performed. Subsequently, it is the formation approach of the hologram which stiffens a record carrier by heat or light, and is characterized by being one of a host monomer and the guest monomers, and the fluorine content compound which has the structure of ** 6, ** 7, ** 8, or ** 9 in a guest monomer preferably.

[0007] Hereafter, the detail of this invention is explained. First, the component which constitutes a record carrier is explained. As a binder polymer, polymethacrylic acid ester or its partial hydrolysate, Polyvinyl acetate or its hydrolyzate, polystyrene, a polyvinyl butyral, Polychloroprene, a polyvinyl chloride, chlorinated polyethylene, chlorination polypropylene, Polly N-vinylcarbazole or its derivative. Polly N-vinyl pyrrolidone, or its derivative, The copolymer of styrene and a maleic anhydride or its half-ester, an acrylic acid, The copolymer which uses as a polymerization component the monomer chosen from the monomer group of acrylic ester, a methacrylic acid, methacrylic ester, acrylamide, acrylic nitril, etc. which can be copolymerized is used.

[0008] They are Polly N-vinylcarbazole or its derivative preferably. For example, a Polly N-vinylcarbazole and vinylcarbazole-styrene copolymer, A vinylcarbazole-vinyl chloride copolymer, a vinylcarbazole-methyl methacrylate copolymer, A vinylcarbazole-vinyl anthracene copolymer, a vinylcarbazole-vinylpyridine copolymer, A vinylcarbazole-acrylate copolymer, a vinylcarbazole-ethyl acrylate copolymer, A vinylcarbazole-acrylonitrile copolymer, a vinylcarbazole-butyl acrylate copolymer, A vinylcarbazole-nitro vinylcarbazole copolymer, nitration Polly N-vinylcarbazole, A polyvinyl amino carbazole and vinylcarbazole-N-methylamino vinylcarbazole copolymer, halogenation Polly N-vinylcarbazole and vinylcarbazole - a jib -- a ROM vinylcarbazole copolymer, poly iodine vinylcarbazole, the poly benzylidene vinylcarbazole, a poly propenyl carbazole, etc. are mentioned. [0009] Next, the compound (host monomer) which can be photopolymerized is explained. As a host monomer, the monomer which has one ethylene nature partial saturation double bond at least, oligomer, prepolymers, and those mixture are mentioned into 1 molecule. Specifically, they are unsaturated carboxylic acid and its salt, the ester of unsaturated carboxylic acid and an aliphatic series polyhydricalcohol compound, the amide of unsaturated carboxylic acid and an aliphatic series multiple-valued amine compound, etc.

[0010] As unsaturated carboxylic acid, an acrylic acid, a methacrylic acid, an itaconic acid, a crotonic acid, isocrotonic acid, maleic acids and these halogenation unsaturated carboxylic acid, for example, chlorination unsaturated carboxylic acid, bromination unsaturated carboxylic acid, etc. are still more specifically mentioned. As a salt of unsaturated carboxylic acid, there are above-mentioned sodium salt, potassium salt, etc. of an acid.

[0011] moreover, as ester of an aliphatic series polyhydric-alcohol compound and unsaturated carboxylic acid Ethylene glycol diacrylate, triethylene glycol diacrylate, 1,3-butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, Propylene glycol diacrylate, neopentyl glycol diacrylate, Trimethylolpropane triacrylate, the TORIMECHI roll pro pantry (acryloyloxypropyl) ether, Trimethylol triacrylate, hexanediol diacrylate, 1, 4-cyclohexane diol diacrylate, tetraethylene glycol diacrylate, Pentaerythritol diacrylate, a pentaerythritol thoria chestnut rate, Pentaerythritol tetraacrylate, dipentaerythritol diacrylate, Dipentaerythritol triacrylate, dipentaerythritol tetraacrylate, Dipentaerythritol hexaacrylate, a sorbitol thoria chestnut rate, Sorbitol tetraacrylate, sorbitol pentaacrylate, Sorbitol hexa acrylate, Tori (acryloyloxyethyl) ISOA nurate, Polyester acrylate oligomer, 2-hydroxypropyl acrylate, Tetrahydrofurfuryl acrylate and ethylene glycol dimethacrylate, Triethylene glycol dimethacrylate, 1,3-butanediol dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, propylene glycol dimethacrylate, Neopentyl glycol dimethacrylate, trimethylolpropanetrimethacrylate, Trimethylolethane trimethacrylate, hexanedioldimethacrylate, 1, 4-cyclohexane diol dimethacrylate, tetraethylene glycol dimethacrylate, Pentaerythritol dimethacrylate, pentaerythritol trimethacrylate, Pentaerythritol tetra-methacrylate, dipentaerythritol dimethacrylate, Dipentaerythritol trimethacrylate, dipentaerythritol tetra-methacrylate, Dipentaerythritol hexamethacrylate, sorbitol trimethacrylate, Sorbitol tetra-methacrylate, sorbitol pentamethacrylate, Sorbitol hexa methacrylate, screw-[p-(3metacryloxy-2-hydroxy propoxy) phenyl] dimethylmethane, screw - [p - (acrylic oxyethoxy phenyl] dimethylmethane, 2-hydroxypropyl methacrylate, etc. are mentioned.)

[0012] As itaconic-acid ester, ethylene glycol di-itaconate, propylene glycol di-itaconate, 1,3-butanediol itaconate, 1,4-butanediol di-itaconate, tetramethylene glycol di-itaconate, pentaerythritol di-itaconate, sorbitol tetra-itaconate, etc. are mentioned.

[0013] As crotonic-acid ester, ethylene GURIKORUJI crotonate, tetramethylene glycol JIKUROTONETO, pentaerythritol JIKUROTONETO, sorbitol tetra-crotonate, etc. are mentioned. [0014] As isocrotonic acid ester, ethylene glycol JIISO crotonate, pentaerythritol JIISO crotonate, sorbitol tetrapod iso crotonate, etc. are mentioned.

[0015] As a maleate, ethylene glycol JIMARETO, pentaerythritol JIMARETO, sorbitol tetra-malate, etc.

are mentioned.

[0016] As halogenation unsaturated carboxylic acid, 2, 2, 3, and 3-tetrafluoropropylacrylate, 1H, 1H and 2H, 2H-heptadeca fluoro decyl acrylate, 2, 2 and 3, 3-tetrafluoro propyl methacrylate, 1H, 1H and 2H, and 2H-heptadeca fluoro DESHIRU methacrylate etc. is mentioned.

[0017] Moreover, as an amide of unsaturated carboxylic acid and an aliphatic series multiple-valued amine compound, methylenebis acrylamide, methylenebis methacrylamide, 1, 6-hexa methylenebis acrylamide, 1, 6-hexamethylene methacrylamide, diethylenetriamine tris acrylamide, xylylene bisacrylamide, xylylene bisacrylamide, an acrylamide butyraldehyde dimethyl acetal, etc. are mentioned.

[0018] The poly isocyanate compound which has two or more isocyanate radicals in one molecule indicated by JP,48-41708,B as other examples, In 1 molecule to which the vinyl monomer containing the hydroxyl group shown by following general formula CH2=C(R1) COOCH2CH(R2) OH (R1 in a formula and R2 express a hydrogen atom or a methyl group) was made to add, two or more polymerization nature vinyl groups The vinyl urethane compound to contain is mentioned.
[0019] Moreover, polyfunctional acrylate and methacrylate, such as polyester acrylate and an epoxy resin which are indicated by the urethane acrylate indicated by JP,51-37193,A, JP,52-30490,A, JP,49-43191,B, and JP,48-64183,A, respectively, and an acrylic (meta), can be mentioned.
[0020] It can use, the halogenide, for example, the bromination object etc., of epoxy acrylate etc. further -- a Japanese adhesion association magazine -- Vol.20, No.7, and 300-308 What is indicated by the page as a photoresist monomer and oligomer can be used. The ester of phenols and unsaturated carboxylic acid, for example, tribromophenol acrylate, tribromophenol methacrylate, tetrabromo phenol acrylate,

[0021] Furthermore, a degree type [** 11]
x ID=000012
[Formula 12]
ID=000013
·

tetrabromobisphenol A di(meth)acrylate, etc. can be used.

It can come out and a thoria chestnut rate [which are expressed / made from Toagosei Chemical industry], for example, product, trade name, AKURONIKUSU M315 or M325 and 2, and 2'-screw (4-acryloxy diethoxyphenyl) propane (the product made from New Nakamura Chemistry, a trade name, NK ester A-BPE -4), tetramethylolmethane tetraacrylate (the product made from New Nakamura Chemistry, a trade name, and NK ester A-TMMT), etc. can be used.

[0022] The following structure expression [** 13]		
☑ ID=000014		
[Formula 14]		
× ID=000015		

[Formula 15]

× ID=000016	
[Formula 16]	
x ID=000017	

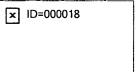
It comes out and four sorts of compounds made from SNPE, for example, a product, expressed, a trade name, ACTICRYL CL 993, 959, 960, and 1039 are effective.

[0023] The fluorine content compound which furthermore has the structure of ** 6, ** 7, ** 8, and ** 9 can also be used.

[0024] Next, as a photopolymerization initiator, it is aromatic ketone [, such as benzoin alkyl ether, ketals, oxime ester, a benzophenone, a thioxan ton derivative, a quinone and thio acridone,], 1, and 3-JI (alkyls, such as t-butyl dioxy carbonyl benzene, iodonium salt, Gia Nin, a rhodamine, a safranine, Malachite Green, and a methylene blue, or alkyl way acid chloride, an iron-arene complex, bisimidazole derivatives, N-aryl glycine, etc. can be used.).

[0025] Moreover, since the sensibility of a photopolymerization initiator is increased, it is desirable to consider as the system which added light sensitizing dye. As light sensitizing dye, aromatic amines, such as a MIHIRAZU ketone, a xanthene dye, thio pyrylium salt, MEROSHININ quinoline system coloring matter, coumarin keto coumarin system coloring matter, an acridine orange, a benzoflavin, Gia Nin, a phthalocyanine, porphin, a rhodamine, a safranine, Malachite Green, methylene Green, etc. are used, for example.

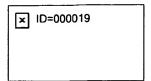
[0026] Especially a desirable thing is the following general formula [** 17].



(R5 in a formula, R6, and R7 express a hydrogen atom, a chlorine atom, a low-grade dialkylamino radical, the low-grade dialkenyl amino group, or the alicyclic amino group, and, as for X, the total of carbon and a hetero atom expresses 5-9 heterocycle radicals or -COY radical, respectively.) Y shows the permutation of carbon numbers 1-4 or an unsubstituted alkyl group, a lower alkoxy group, a permutation or an unsubstituted phenyl group, a permutation, an unsubstituted sterile radical, a permutation, or an unsubstituted 3'-KUMARINO radical, and Z shows a hydrogen atom or a cyano group here. It is the system of the polymerization initiator which consists of a coumarin compound expressed and organic peroxide. In an upper type, low-grade dialkenyl amino groups, such as alicyclic amino groups, such as low-grade dialkylamino radicals, such as lower alkoxy groups, such as hydrogen atom, chlorine atom, methoxy, and ethoxy ** butoxy, dimethylamino, diethylamino, and N-methyl-N-propylamino, N-morpholino, and N-piperidino, dipropenyl amino, and a JI (alpha-methyl propenyl) amino group, etc. are mentioned preferably as R5, R6, and R7.

[0027] As a heterocycle radical in X, moreover, 2-imidazole, a 2-N-methyl imidazole, 2-benzimidazole 2-(4-phenyl)- An imidazole, 2-oxazole, 2-benzoxazole, 2-(4-phenyl) oxazole, 2-thiazole, 2-bends thiazole, 2-(4-phenyl) thiadiazole, 2-(5-phenyl) thiadiazole, Residue, such as 2-(5-tolyl) thiadiazole, 2-(5-phenyl) thiadiazole, 2-(5-phenyl) OKISA diazole, and 2-(5-p-KURORU phenyl) OKISA diazole, is mentioned.

[0028] As Y in -COY radical, furthermore, methyl, ethyl, propyl, Permutations, such as hexyl, betacyano ethyl, ethoxy carbonylmethyl, and butoxy carbonylmethyl, or unsubstituted C1 - C6 Alkyl group, Phenyl, p-cyanophenyl, p-methylphenyl, p-methoxypheny, Sterile radicals, such as permutations, such as m-hydroxy carbonyl phenyl, or an unsubstituted phenyl group, sterile one, p-methoxy sterile, p-cyano sterile, and m-KURORU sterile, and the following general formula [** 18]



3-KUMARINO radical expressed with (the inside R5 of a formula, R6, R7, and Z show the same thing as the thing in the above-izing 17) is mentioned.

[0029] As an example of a coumarin compound, a 3-acetyl-7-dimethylamino coumarin, A 3-benzoyl-7-dimethyl-amino coumarin, the 3-benzoyl -5, 7-dimethoxy coumarin, Methyl, 7-diethylamino-3-KUMARI noil acetate, a 3-cinnamoyl-7-diethylamino coumarin, A 3 and 3'-carbonyl screw (7-diethylamino) coumarin, 3, and 3'-carbonyl screw (5, 7-dimethoxy amino) coumarin, 7-diethylamino -5, 7'-dimethoxy -3, 3'-bisque marine ** A 3-(2'-bends imidazoyl)-7-diethylamino coumarin, A 3-(2'-bends thiazoyl)-7-diethylamino coumarin, A 3-(5'-phenyl thiazoyl - 2')-7-diethylamino coumarin, 3-(2'-bends thiazoyl)-7-diethylamino coumarin, 3, and 3'-carbonyl screw (4-cyano-7-diethylamino) coumarin etc. is mentioned.

[0030] the rate of organic peroxide and a coumarin compound -- the coumarin compound 1 weight section -- receiving -- organic peroxide 1 weight section -100 the weight section -- preferably, to the coumarin compound 1 weight section, organic peroxide 1 weight section - 50 weight section comes out comparatively, and it is used.

[0031] The presentation ratio of each component which constitutes a record carrier is the binder polymer 100 preferably. It is a host monomer to the weight section 10 weight section -300 It is the system of the photopolymerization initiator containing the weight section, a photopolymerization initiator, or light sensitizing dye 1-100 It is the weight section. It is the binder polymer 100 especially preferably. It is a host monomer to the weight section 30 weight section -150 In accordance with the weight section, a photopolymerization initiator, and light sensitizing dye, it is used at a rate of 1 to 30 weight sections. [weight]

[0032] Moreover, to a record carrier, components other than the above-mentioned constituent, such as an oxygen trapping agent, thermal polymerization inhibitor, a plasticizer, and an ultraviolet ray absorbent, can also be added.

[0033] In this invention, the above-mentioned constituent is dissolved in solvents, such as benzene, chlorobenzene, a tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,2-dichloroethane, dichloromethane, and chloroform, and it considers as sensitization liquid, and applies on the plate made of glass or transparence resin, or a film. It dries after that, a solvent is evaporated and a record carrier is obtained.

[0034] as the method of application of sensitization liquid -- spinner coating, blade coating, roll coating, etc. -- it is -- after desiccation and thickness -- 1 micrometer - 100 micrometer It applies so that it may become. Although adjustment of thickness is performed by the concentration of the constituent in a solvent, the thickness at the time of spreading, etc., several spreading and desiccation can be repeated depending on the case, and a thick film can also be obtained. In addition, itself may be film-ized using the support nature of the binder polymer itself. Furthermore, if a polyvinyl alcohol water solution etc. performs coating and air is intercepted, the polymerization inhibition by oxygen does not arise in the field in contact with the air of a record carrier, but sensibility can be raised to it.

[0035] thus, the record carrier obtained -- for example, 457.9nm, 488nm, 514.5nm, and 528.7nm etc. -- the laser light which has the bright line -- sensibility -- having -- **** -- for example, 488nm the Ar ion laser which has wavelength -- receiving -- 1 - 500 mJ/cm2 The diffraction efficiency in a practical use region is given with energy.

[0036] Next, the hologram formation approach of this invention is explained. The hologram formation approach of this invention depends a host monomer on the light or the heat-curing process of a record carrier permuted partially by the exposure process of the record carrier to a radiant ray, the development process which uses the developer containing a guest monomer, and the guest monomer. In the exposure process to the radiant ray of a record carrier, the radiant ray which makes a laser beam, a mercury lamp,

etc. the light source is desirable as a radiant ray which can be used.

[0037] When forming the mirror to a certain specific wavelength on the occasion of hologram formation, for example, Lippmann mold hologram formation equipment like <u>drawing 1</u> and DENISHUKU mold hologram formation equipment like <u>drawing 2</u> are used. Moreover, 500nm which is sent from an argon laser If the optical system which used <u>drawing 3</u> or a glass block like <u>drawing 4</u> is used even if it uses the light of the wavelength of order, mirrors which reflect the beam of light of long wave length comparatively, such as a near infrared ray, can be formed. in addition, <u>drawing 1</u> - <u>drawing 4</u> -- setting -- 1 -- an argon laser and 2 -- a spatial filter and 3 -- a lens and 4 -- a record carrier and 5 -- in an aluminum flat-surface mirror and 6, a mirror and 9 show a half mirror and, as for refractive-index matching liquid and 7, 10 shows a glass block, as for a laser beam and 8.

[0038] Next, a development is performed to a record carrier. The coating film is removed when coating processing by polyvinyl alcohol etc. is performed to the exposure of a record carrier before exposure. A development is performed by being immersed in the developer containing the compound which makes the polymerization of the developer or guest monomer which contains a guest monomer for the record carrier in which the hologram latent image was formed, and a guest monomer start. If the compound for making a developer start the polymerization of a guest monomer is added, the hologram performed next is quickly fixable. This development process makes the developer containing a guest monomer and a polymerization initiator permeate into a record carrier, permutes the low polymerization-degree component of the host monomer of a non-polymerization, or a host monomer by the guest monomer, or makes a host monomer add a guest monomer to it while making a record carrier carry out elution of the low polymerization-degree component of the host monomer of a non-polymerization, or a host monomer into a developer according to that formed hologram pattern.

[0039] The solvent in a developer seldom dissolves the polymer of the binder polymer and host monomer in the record carrier which had the hologram latent image formed of exposure, or hardly dissolves and must carry out elution of the component of low polymerization degree of the host monomer of a non-polymerization, or a host monomer promptly. Moreover, the function to make a record carrier produce swelling or contraction may be included. Specifically For example, benzene, toluene, a xylene, ethylbenzene, n-propyl benzene, a cumene, a phenol, cresol, chlorobenzene, Dichlorobenzene, a nitrobenzene, benzyl alcohol, benzyl chloride, Benzene, such as a benzyl star's picture, an alpha methyl naphthalene, and alpha-chloronaphthalene, The derivative of naphthalene and n pentane, n-hexane, n-heptane, Alkanes, such as n-octane, an isooctane, and a cyclohexane, and cycloalkanes Methyl alcohol, ethyl alcohol, n-propyl alcohol, isopropyl alcohol, n-butyl alcohol, t-butyl alcohol, n-amyl alcohol, Alcohols, such as isoamyl alcohol, diethylether, the methylethyl ether, Ester, such as ketones, such as ether, such as diisopropyl ether, an acetone, and a methyl ethyl ketone, ethyl acetate, methyl acetate, ethyl formate, and methyl propionate, is used, and these mixed solvents may be used.

[0040] Next, the compound (guest monomer) in which the light in a developer or thermal polymerization is possible is explained. What was indicated as a host monomer as a guest monomer can be used. However, the fluorine compound which has the structure of ** 6, ** 7, ** 8, or ** 9 must be used for one of a host monomer and the guest monomers. The above-mentioned fluorine compound is preferably used for a guest monomer.

[0041] When adding a polymerization initiator to a developer, what is described below can be used. When stiffening a guest monomer according to photopolymerization, it is aromatic ketone [, such as for example, benzoin alkyl ether, ketals oxime ester, a benzophenone, a thioxan ton derivative, a quinone and thio acridone,], 1, and 3-JI (alkyls, such as t-butyl dioxy carbonyl benzene, iodonium salt, Gia Nin, a rhodamine, a safranine, Malachite Green, and a methylene blue, or alkyl way acid chloride, an ironarene complex, bis-imidazole derivatives, N-aryl glycine, etc. can be used.).

[0042] Methyl ketone peroxide, cyclohexanon peroxide, acetylacetone peroxide,

Since it became timeout time, translation result display processing is stopped.